

2018年度第2回 ナノファブスクエア 講習・実習会 レーザー直接描画装置



日時

2018年5月31日(木)
13:30~16:30 ※講習1時間、実習2時間

場所

かわさき新産業創造センター(KBIC)新館
NANOBI C (川崎市幸区新川崎7-7 新川崎・創造のもり
JR新川崎駅から徒歩10分)

講師

山本 貴富喜 (東京工業大学工学院 准教授)

初心者
歓迎

実習内容

フォトレジストへのリソグラフィの体験実習

実習機器

レーザー直接描画装置
(Heidelber Instruments Mikrotechnik社製DWL66fs)*

*機器詳細仕様は「NANOBI Cオープンラボ」ホームページ <http://open-labo.skr.jp/> の機器一覧をご覧ください。
慶應、早稲田、東工大、東大からなる4大学ナノ・マイクロファブ리케이션コンソーシアムでは、川崎市、KISTECと連携し、産学連携による新しい技術や産業の創出を図るため、新川崎・創造のもりのナノ・マイクロ産学官共同研究施設「NANOBI C」において、4大学の先端機器の利用開放を行っています。今後、更に効果的に機器のご活用いただくため、企業や大学の方を対象とした「レーザー直接描画装置講習・実習会」を開催しますのでご参加ください。

定員：先着5名程度 参加費：1万円(実費)

主催：4大学ナノ・マイクロファブ리케이션コンソーシアム、(地独)神奈川県立産業技術総合研究所、川崎市

共催：次世代マイクロ化学チップコンソーシアム

問い合わせ先

技術担当 唐澤 志郎 Tel: 080-6560-3061 / E-mail: karasawa@newkast.or.jp (地独) 神奈川県立産業技術総合研究所

事務担当 真期 彰 Tel: 080-6560-3060 / E-mail: a-maki@newkast.or.jp 新川崎・創造のもり NANOBI C事務室

※川崎市中小企業は、川崎市ナノ・マイクロ機器利用促進補助金(URL: <http://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000096217.html>) がご利用できますのでご相談ください